



川崎市

初心者歓迎

フォトマスク作製

2024年度第1回 ナノファブスクエア 講習・実習会

場所

AIRBIC 会議室 1

(川崎市幸区新川崎 7-7 新川崎・創造のもり
JR新川崎駅から徒歩10分)

講師

山本 貴富喜 先生 (東京工業大学工学院 准教授)

実習内容

フォトレジストへのリソグラフィの体験実習

実習機器

レーザー直接描画装置

(Heidelberg Instruments Mikrotechnik社製 DWL66fs) *

* 機器詳細仕様は「NANOBIICオープンラボ」ホームページ
<https://open-labo.skr.jp/> の設備一覧をご覧ください。

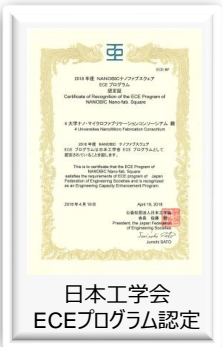
5 / 9 (木)

13:30 - 16:30

※講習1時間、実習2時間



申込フォーム



慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「フォトマスク作製 講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

定員：先着5名程度 参加費：13,000円

主催：4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市
申込：下記申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.gle/6gTKRQipc7DrACPY6>

問い合わせ先

篠原 俊朗 Tel:080-6560-3061

真期 彰 Tel: 080-6560-3060

E-mail: nano-micro@open-labo.jp (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 新川崎・創造のもり NANOBIIC事務室